ピレンにおける電子励起状態経由 Stone-Wales 転位の非断熱反応経路

(東北大院理) 〇山崎 馨, 新津 直幸, 河野 裕彦

図 1 に示すような Stone-Wales 転位 (SWR)は、グラフェン・カーボンナノチ ューブ(CNT)・フラーレンなどのナノカ ーボンにおける主要な構造欠陥生成反応 の一つである[1].この反応によって、ナノ カーボンの電気伝導性[2]や励起子寿命[3] などの電磁気学的・光学的特性が大きく 変わることが知られている.つまり、SWR の制御が可能になれば、ナノカーボンの



青色の C-C 結合が結合の開裂・再形成に関与する

物性制御が可能になることが期待される. Valencia らは, Tight-binding 法に基づく非断熱分子動 力学法を使用して可視領域フェムト秒レーザーパルスによってグラフェンとカーボンナノチュー ブの逆 SWR が誘起できることを理論的に示した [4,5]. これは, グラフェンにおける SWR にお いて, 電子励起状態経由の反応経路が存在することを理論的に示唆するものである. しかし, 電 子励起状態経由 SWR における State-specific な反応経路(中間体など)に関する知見は皆無である. また, SWR は複数の C-C 結合の開裂・再形成を伴う反応である (図 1). この様な反応が電子励 起状態において起きるときには, ポテンシャルエネルギー局面 (PES)の擬交差による非断熱遷 移がしばしば生じる. この非断熱遷移が反応経路の分岐など, SWR の反応経路に大きな影響を与

えることが予想される.

それでは、電子励起と非断熱遷移は SWR の反応経路にどの様な影響を与えているのであろうか. 我々は最低電子励起一重項状態(S₁状態)経由 SWR の反応経路を計算し、電子基底状態(S₀

状態)経由の反応経路と比較した.モデル分 子にはピレンを用いた.ピレンモデルにおけ る S₀断熱経路の反応障壁 $\Delta E^{\dagger}_{DFT}(S_0)$ は B3LYP 法で 8.21 eV と見積もられ,グラフェンナノリ ボン($\Delta E^{\dagger}_{DFT}(S_0) = 8.0 \text{ eV}$)[5]及び単層 CNT($\Delta E^{\dagger}_{DFT}(S_0) = 8.5 \text{ eV}$)[6]における過去の DFT 計算の値と良い一致を示している.なお, 今回の計算には[6,6]-MS-CASPT2/6-31G(2d,p)// [6,6]-SA-CASSCF/6-31G(2d,p)法

(MS-CASPT2//SA-CASSCF 法)を用いた.本計算方法は、反応前のピレンと反応後のアズピ

表 1: MS-CASPT2//SA-CASSCF 法を用いて計 算されたピレンとアズピレンにおける S₀状態 から S₁ 状態と S₂ 状態への垂直励起エネルギ ーと実験値との比較.

分子構造	手法	S_1/eV	S_2/eV
ピレン	計算*	3.32	3.91
	実験[6]	3.38	3.87
アズピレン	計算*	1.77	2.39
	実験[7]	1.61	2.57

*本研究による結果

レンにおける So状態から S1状態と S2状態への垂直励起エネルギーの実験値をよく再現した(表1).

図 2 に, ピレンにおけ る SWR の反応エネルギ ーダイアグラムを示す[8]. S₁ 状態に励起された分子 は, S₁状態と S₁状態間の 擬交差 1 (擬交差 1) にお いて, S₀ 状態に非断熱遷 移する反応経路 (S₁/S₀ 非 断熱経路) とそのまま S₁ 状態の PES 上で反応する反 応経路 (S₁断熱経路) に分岐 することが分かった (図 2).



図2: ピレンにおける電子励起状態経由 Stone-Wales 転位の 反応エネルギーダイアグラム.

 S_1/S_0 非断熱経路の実質的な「遷移状態」は擬交差1であり,一旦 擬交差1を通過すると、 S_0 状態の中間体から S_1/S_0 擬交差2を経由 して反応が進行すると考えられる(図 2). この反応経路における実 効的な反応障壁 ΔE^{\dagger} は 6.15 eV(基準点は S_1 状態におけるピレンの 平衡構造)と計算された(表 2).一方、 S_1 断熱経路においては S_2 状態と S_1 状態間の擬交差(S_2/S_1 擬交差3)が実質的な「遷移状態」 の役割を果たしていると考えられる(ΔE^{\dagger} =8.93 eV,表 2).この擬 交差を通過した分子は、擬交差2において S_0 状態へと非断熱遷移 してアズピレンに至ると考えられる[8]. **表 2**: 電子基底状態経路と 電子励起状態経路におけ る Stone-Wales 転位の反応 障壁 Δ*E*[‡]の比較

反応経路	$\Delta E^{\ddagger}/eV$
S ₀ 断熱	9.25
S_1 断熱	8.93
S ₁ /S ₀ 非断熱	6.15

また、S₁/S₀非断熱経路における反応機構がラジカル的である

かイオン的であるかを判別するために,各擬交差領域・中間体及び安定構造における CI 係数 を比較した.その結果,ピレンから擬交差1に至るまでの C-C 結合の解離(図 2)はラジカル的 機構であったのに対して,擬交差1から S₀中間体に至る C-C 結合の解離(図 2)はイオン的な 機構であることが分かった[8].これは,ピレンから擬交差1に至るまでの多配置波動関数の 主配置が開殻配置であったものが擬交差1から S₀中間体に至る区間では閉殻配置へと変化し ていることに相当する.

現在, S_1/S_0 非断熱経路と S_1 断熱経路のPESをMS-CASPT2//SA-CASSCF法によって計算中である.より詳細な反応機構については当日報告する.

以上より,電子励起と非断熱遷移による反応経路の分岐を組み合わせることによって,SWR において新たな非断熱反応経路が開けることが明らかになった.

参考文献:

[1] Neto et al., Rev. Mod. Phys. 2009, 81, 109-162; [2] Wang, Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 11939-11945; [3] Habenicht et al., Phys. Rev Lett. 2008, 100,197402; [4] Valencia et al., Phys. Rev. B. 2006,74, 075409; [5] Romero. et al., Nano. Lett. 2005, 5 (7), 1361-1365; [6] Mangle et al., J. Phys. Chem. 1986, 90 (5), 802-807; [7] Anderson et al., J. Am. Chem. Soc. 1968, 90 (2), 2993-2994; [8] Yamazaki et al., in preparation.